行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

氣體壓鑄法製造 ZnO 和 Bi 203 陣列式奈米線材(1/3)

<u>計畫類別</u>: 個別型計畫 <u>計畫編號</u>: NSC92-2216-E-009-019-<u>執行期間</u>: 92 年 08 月 01 日至 93 年 07 月 31 日 執行單位: 國立交通大學材料科學工程研究所

計畫主持人: 朝春光

<u>報告類型:</u>精簡報告

<u>處理方式:</u>本計畫可公開查詢

中 華 民 國 93 年 5 月 31 日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫期中進度報告

吳政翰 林祺淵

交通大學材料工程學系

(NSC92-2216-E009-019/氣體壓鑄法製造 ZnO 和 Bi203 陣列式奈米線材(1/3))

(一) 摘要

奈米技術應用於目前之工程科技 上有良好的發展潛能。近年來文獻中 提及其製造技術,多以半導體技術為 製程, 製程中要求高真空度, 昂貴的 儀器設備,而且製程時間甚長,相對 地使奈米材料(元件)於量產上受到了 限制。本研究計劃將提供一簡便製造 奈米線材之製程與方法,改善以上諸 問題,將利用高純度鋁(99.999%)經陽 極處理後製得陣列式奈米孔洞,再以 真空氣壓注入(Vacuum Melting and Gas Pressure Injection Process)法将低 熔點之熔融金屬(Bi,Zn)壓注入奈米孔 洞內,而製得奈米金屬線材,並使奈 米線材經熱氧化後得奈米氧化物線 材,量测奈米氧化物之單色發光效應 表現其特殊之物理特性

(二)前言

奈米材料(Nano-meterials)不論在 光學、生物科技、光電元件、感測材 料、微電子元件或半導體等科技上均 有良好的發展潛能[1-3],奈米材料除了 可使材料密度或元件使用時堆積密度 大大地提高外,另外,當材料小於某 一尺寸時(介觀;mesoscopy))將呈現 與巨觀材料不同的物理和化學性質, 如銅的熔點為 1085°C而 20nm銅微粒 的熔點僅 39°C、將使其電阻值降低甚 至達無電阻狀態、將使其由親水性變 為斥水性材料,而目前奈米科技已有 的研究成果則包括許多:量子計算機、 量子磁碟、單電子電晶體、微型感測 器、奈米電容器、奈米發光器......等 成果^[4-6]。奈米材料的研究領域可區分 為:陣列式奈米模板的製作,奈米點/ 線材的製作,奈米材料特性的量測, 奈米材料的應

用等方向,雖然Al203 陣列式奈米孔洞 的反應機構早於1978年已由美國貝爾 實驗室的Thompson^[7]初步提出,但至今 仍有許多疑點尚待釐清。。奈米線材 製程中常以AAO為模板,將金屬元素填 入該模板中,形成奈米金屬點、

線、帶等,常見的技術如電鍍法^[8,9]、 化學/物理氣相沉積法、凝膠-凝固 法、熱處理法、壓鑄^[4,5]等方法。其中 電鍍法和凝膠-凝固法可於常壓下進 行,然而,其對控制參數的敏感度亦 較高,而化學氣相沉積法、熱處理法、 壓鑄法需於真空下進行,相對地,其 品質亦較易控制。

(三)實驗方法

為了獲得氧化鋅奈米線,本實驗以兩 種不同製程方式來製作奈米線: (一)直流電鍍法,是利用高純度鋁 (99.999%)經電化學之陽極處理法製 作不同孔徑與厚度之氧化鋁陽極膜模 板(anodic aluminum oxide; AAO),再 利用電鍍法將低熔點元素(Zn)經電鍍 後氧化鋁陽極膜模板內,製得奈米金 屬線材。,因此,本研究中經以上所 製得之奈米線材,再將其經過氧氣氣 氛爐氧化後得該氧化物,最後再以光 激發光能譜儀(Photoluminescencer)量 測各種不同直徑奈米氧化物之發光特 性。

(二)氣相物理蒸鍍法,是利用物理氣 相沉積^[10-12]之方式來生成筆直的氧化 鋅奈米柱。先將純鋅粉(99.9999%)與矽 晶圓片置入石英玻璃管內,再置入熱 處理爐中;加熱至其Zn沸點(950°C)以 上,使其高溫熱氧化,直接沉積於矽 晶圓片上;再經由光激發光能譜儀 (Photoluminescencer)量測於可見波長 範圍內的發光特性。

(四)結果與討論

(一)直流電鍍法之氧化鋅奈米線

本實驗的陽極氧化鋁模板(AAO) 孔洞直徑為185.5nm、深度 60µm(如圖 a、b所示),之後將陽極氧化鋁模板 (AAO)鍍金, 放置於 80g/l硫酸鋅 (ZnSO₄、7H₂O)和 20g/l硼酸(H₃BO₃)的 電鍍液,以2V的工作電壓電鍍鋅的奈 米線,之後再經過400°C、40hr熱處 理,將AAO/鋅(Zn)金屬線氧化成AAO/ 氧化鋅之奈米陣列(如圖c所示),為了 獲得單根氧化鋅奈米線,利用 6M/氫 氧化鈉(NaOH)溶解陽極氧化鋁(AAO) 的特性,再以滴管吸取數滴溶液,滴 至400mesh的鍍碳銅網上並烘乾,而獲 得氧化鋅之奈米線(ZnO nanorod),最 後把樣品放置TEM下觀察。觀察TEM 時,會發現到AAO的繞射圖形出現不 明顯的繞射環,顯示著AAO模板非晶 質的結構,而圖(d)、(e)的電子束從(002) 方向打下去的,可以清晰的見到氧化

鋅奈米線較黑,顯示出氧化鋅奈米線 是六角柱狀實心,而繞射圖形則可看 出六角形的HCP結構(繞射面方向 (102)、(101)),和XRD的結果來量測跟 比對,可以得知利用電鍍方法所得到 的氧化鋅奈米線是屬於wurtizte 結 構,但可能是結晶度不夠或是雜訊的 影響,造成繞射點不夠清楚明顯(繞射 環是銅網貢獻的結果,其繞射面由內 至外的順序為(200)、(220)),顯示出有 些多晶面的產生,綜合一些文獻的結 果,可發現到利用電鍍方法合成的氧 化鋅奈米線並非可以達到完全的單 晶。氧化鋅的能帶 3.2eV,因此,發光 波長 387.5nm,偏向紫光部分,但是一 般的氧化鋅量測PL之後,都會發現到 有藍、绿光的出現,這是因為氧化鋅 當中的氧空孔會造成能帶降低(能帶≡ 2.53eV), 而發出藍、绿光, 從圖(f)可 以看出發光波長分成兩大部分,一個 是偏紫光的 386nm波長,一個則是偏 绿光的 491nm波長,因此,可以看出 利用電鍍的方式,相當容易造成氧空 孔的產生,進而使得波長偏向绿光的 部分。

(二)氣相物理蒸鍍法之氧化鋅奈米線 如 SEM 圖(g)、(h)所示,由熱氧化 氣相沉積法所得的氧化鋅奈米柱,可 得到與電鍍法相當之尺度。TEM 明場 影像與擇區繞射圖(如圖(i)、(j))顯示出 其單晶氧化鋅(100)、(102)的繞射結 構,因為繞射點比電鍍法來的明顯許 多,表示鋅蒸氣與高溫氧結合成氧化 鋅後,再慢慢沉積於矽基材上,所以 所得到之氧化鋅奈米柱大部分皆為單 晶。且由 PL 譜圖可得知(如圖(k)所 示),顯示出氣相物理蒸鍍法之氧化鋅 奈米線發光效應與電鍍法一致,表示 氧化鋅奈米柱的結晶狀態的表面缺氧 態濃度約佔總發光面積區域的一半比 例。

(四)参考文獻

- Ying, "<u>Process for Fabricating an</u> <u>Array of Nanowires</u>", United States Patent, Patent No. : 6231744, 2001.
- Yiying Wu, Hannes Kid,
 "<u>Room-Temperature Ultraviolet</u> <u>Nanowire Nanolasers</u> ", Science, Vol. 292, No. 8, 2001, P1897-1899.
- C. A. Huber, T. E. Huber, "<u>Nanowire</u> <u>Array Composites</u>", Science, Vol. 263, No. 11, 1994, P800-802.
- Zhibo Zhang, Xiangzhong Sun,
 "<u>Electronic Transport Properties of</u> <u>Single-crystal Bismuth Nanowire</u> <u>Arrays</u>", Physical Review B, Vol. 61, No. 7, 2000, P4850-4861.
- 5. A. J. Yin, J. Li, "<u>Fabrication of</u> <u>Highly Ordered Metallic Nanowire</u> <u>Arrays by Electrodeposition</u>", Applied Physicals Letters, Vol. 79,

No. 7, 2001, P1039-1041.

6. Y. C. Kong, D. P. Yu, "<u>Ultraviolet-emitting ZnO</u> <u>Nanowires synthesized by a</u> <u>Physical Vapor Deposition</u>

<u>Approach</u> ", Applied Physics Letters, Vol. 78, No. 4, P. 407-409, 2001.

- G. E. Thompson, R. C. Furneaux, "<u>Nucleation and Growth of porous</u> <u>Anodic Films on Aluminum</u>", Nature, Vol. 272, 1978, P433-435.
- 8. K. Nielsch, R. B. Wehrspohn, "<u>Hexagonally Ordered 100 nm</u> <u>Period Nickel Nanowire Arrays</u>",

Applied Physicals Letters, Vol. 79, No. 9, 2001, P1360-1362.

9. G. J. Strijkers, J. H. J. Dalderop, "<u>Structure and Magnetization of</u> <u>Array of Electrodeposited Co Wires</u> <u>in Anodic Alumina</u>", Journal of Applied Physicals, Vol. 86, No. 9, 1999, P5141-5145.

10.Michael H. Huang, S. Mao, Haoquan Yan, "<u>Room-Temperature Ultraviolet</u> <u>Nanowire Nanolasers</u>", Science, 8 June 2001, vol. 292, pp. 1897-1899

11.Peidong Yang, Haoquan Yan, S. Mao, "<u>Controlled Growth of ZnO Nanowires</u> <u>and Their Optical Properties</u>", Advanced Function Materials, May 2002, vol. 12, pp. 323-331

12.Q. X. Zhao, M. Willander, "<u>Optical</u> <u>Recombination of ZnO Nanowires</u> <u>Grown on Sapphire and Si Substrates</u>", Applied Physics Letters, 7 July 2003, vol. 83, pp. 165-167



商用 AAO 之 AFM 表面型態



商用 AAO 之 SEM 俯視圖



電鍍法氧化鋅(ZnO)奈米陣列



電鍍



氧化鋅奈米線之繞射圖形



氧化鋅(ZnO)/商用(commercial)AAO



氧化鋅氣相沉積於矽基材上



氣相沉積法所得之氧化鋅奈米柱



單晶氧化鋅奈米柱之 TEM 明場圖



單晶氧化鋅奈米柱之擇區繞射圖形



氣相沉積法的氧化鋅奈米線 PL 分析